磁気相転移に伴う Dy/NiFe 2 層膜のスピン吸収効率の変化

慶大^A,中国科学院大^B,原研^C,理研^D,慶大スピン研^E 山野井 一人^A,榊原有理^A,藤本純治^B,松尾衛^{B,C,D},能崎幸雄^{A,E} Variation of spin sink efficiency in Dy/NiFe bilayer owing to magnetic phase transition ^ADept. of Phys. Keio Univ., ^BUCAS., ^CJAEA, ^DRIKEN, ^EKeio Spintronics Center K. Yamanoi^A, Y. Sakakibara^A, J. Fujimoto^B, M. Matsuo^{B, C, D}, and Y. Nozaki^{A, E}

<u>はじめに</u>

4f-希土類金属は強いスピン軌道相互作用を有するため、次世代のスピントロニクス材料や永久磁石の要素 元素として不可欠な材料群である。中でも Dy は温度により強磁性と反強磁性(らせん磁性)の2種類の磁

気秩序状態を同一材料で実現できるため、磁気とスピン散乱の 相関を系統的に調べる上で理想的な系である。Dyのらせん磁 性はハイゼンベルグ型の交換相互作用とRKKY相互作用の競 合により実現することが知られている。近年、反強磁性体を用 いた長距離スピン流輸送¹やスピン揺らぎを用いた巨大スピン ホール効果²など興味深い物理現象も報告されている。そこで 本研究では、Dyと強磁性NiFeを接合した2層膜のギルバート ダンピング定数を測定することにより、磁気相転移に伴うDy のスピン吸収効率の変化を評価した。



実験方法及び結果

図 1.25~150 mT の範囲の異なる静磁場で測 定した Dy/NiFe 2 層膜の FMR スペクトル

マグネトロンスパッタリング法により、熱酸化 Si 基板上に Ta(3 nm)/Dy(50 nm)/NiFe(20 nm) 多層膜を連続成膜した。Dy 成膜時のみ基板を 350 度に加熱し、他の金属は 室温成膜した。その後、イオンミリング装置とレーザー描画装置を用いて、多層膜を細線形状に加工し、そ の上から Ti/Au で構成されるマイクロ波導波路を作製した。まず、Dy 薄膜の磁気特性の温度依存性を評価 するために、200 mT の静磁場下で Dy-磁化の温度依存性を測定した。その結果、130~178 K の温度範囲にて 反強磁性相が出現することが分かった。図1 に、ベクトルネットワークアナライザを用いて測定した室温に おける導波路の S₁₁パラメータの周波数依存性を示す。マイクロ波の吸収が見られる周波数が静磁場強度に依 存して変化しており、Dy に接合した NiFe の FMR 周波数と一致した。同様の実験を 110~300 K の範囲の任

意の温度にて実施し、スペクトルの半値幅の周波数依存性から有効 ダンピングの温度依存性を評価した。更に、NiFe/Dyの有効ダンピ ングから、NiFe 単層でのダンピング定数の温度依存性を差し引く ことで、Dyのスピン吸収効果を算出した結果を図2に示す。Dy のスピン吸収効果は、常磁性(PM)から反強磁性(AFM)への相転移 点では極大を示した一方で、AFMから強磁性(FM)への相転移点 では単調に増加した。前者は、スピン吸収効果が相転移点近傍にお けるスピン揺らぎにより増大することを示している³。また FM に 対して AFM ではスピン吸収効果が大幅に低下し、PM と同程度で あることが分かった。

発表では、Dy のスピンポンピング効果に加えて、Dy のスピン ホール角に関しても議論する予定である。





参考文献

- 1) R. Lebrun, A. Ross, S. A. Bender, A. Qaiumzadeh, L. Baldrati, J. Cramer, A. Brataas, R. A. Duine and M. Kläui, Nature (2018).
- 2) Y. Niimi, M. Kimata, Y. Omori, B. Gu, T. Ziman, S. Maekawa, A. Fert and Y. Otani, PRL 115, 196602 (2015).
- 3) Y. Ohnuma, H. Adachi, E. Saitoh and S. Maekawa, PRB 89, 174417 (2014).